

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-29790

(43) 公開日 平成8年(1996)2月2日

(51) Int.Cl.⁶

G 0 2 F 1/1337
1/136

識別記号

5 0 5

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平6-165381

(22) 出願日 平成6年(1994)7月18日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 荻島 清志

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

(72) 発明者 島田 伸二

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

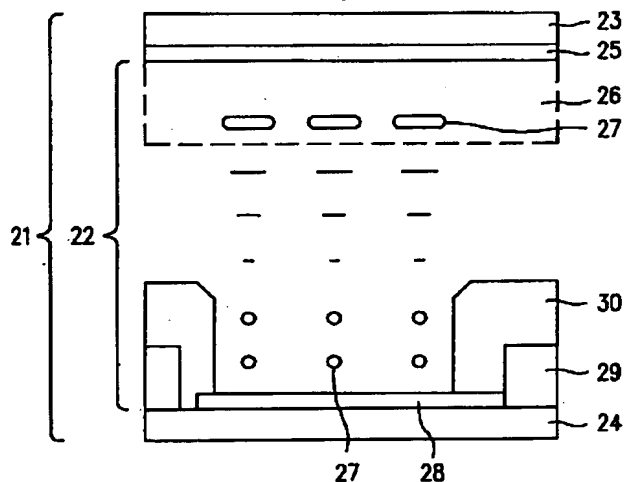
(74) 代理人 弁理士 山本 秀策

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】 複雑な配向処理を用いずに液晶分子の配向制御を行って、製造工程を簡略化することができ、さらに視角依存性を改善する。

【構成】 一对の基板のうち一方の基板23上には透明電極5が形成され、他方の基板24上には透明電極28および薄膜トランジスタ29が形成されている。その上に樹脂BMからなる提状ラインパターン26、30が形成されている。これら提状ラインパターン26、30は平行配向力を有するので、液晶分子27が提状ラインパターン26、30の側面に対して平行に配向する。また、提状ラインパターン26、30の樹脂BMに垂直配向剤を塗布すると、液晶分子27は提状ラインパターン26、30の側面に対して垂直に配向する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に挟まれた液晶層に信号電圧を印加して画像表示する液晶表示装置において、該基板の液晶層側表面に、側面の表面が少なくとも液晶配向樹脂からなり、該液晶層の液晶分子が該側面に対して略平行または垂直に配向する複数の提状ラインパターンをそれぞれ間隔をおいて設けた液晶表示装置。

【請求項2】 前記複数の提状ラインパターンの側面がテーパ角を有し、前記一対の基板間に挟まれた液晶層の液晶分子が該側面に対して略垂直に配向され、該提状ラインパターンで仕切られた領域が、該液晶分子の配向状態が異なる複数の領域に分割されている請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記一対の基板の両方に前記提状ラインパターンが形成され、一方の基板上の提状ラインパターンと他方の基板上の提状ラインパターンとが液晶分子のねじれ角となる角度で交差している請求項1または2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記提状ラインパターンの厚みが0.5 μm 以上であり、かつ、前記一対の基板の間隔の1/2未満である請求項1、2および3のうちのいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記液晶層を間に挟んで対向配設される前記一対の基板のうち、一方の基板の液晶層側表面に第1電極が形成され、他方の基板の液晶層側表面に第2電極が形成された液晶表示装置において、該第1の電極および第2の電極のうち少なくとも一方の電極上に配向膜が設けられている請求項1、2および3のうちのいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記提状ラインパターンが遮光性を有する請求項1、2、3および4のうちのいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記提状ラインパターンが、アクリル、ポリイミド、ノボラック、ポリビニルアルコール、ポリケイ皮酸エステル系およびポリアクリル酸エステル系のうち、少なくとも1種類の樹脂を含む材料からなる請求項1、2、3および4のうちのいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、各々電極が形成された一対の基板間に液晶層が挟持された液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、液晶表示装置においては、基板間に挟持された液晶層に電圧を印加して液晶分子の配向を変化させることにより生じる光学的屈折率変化を利用して表示を行う、いわゆる電気光学効果を利用したものが知られている。このような液晶表示装置として、ネマティック液晶を用いたTN（ツイステッドネマティック）

型やSTN（スーパーツイステッドネマティック）型などの液晶表示装置が実用化されている。また、近年においては、電界効果複屈折効果を使用したECB（電界効果複屈折）型や二色性色素を用いたGH（ゲストホスト）型なども一部実用化されている。

【0003】 このような液晶表示装置のうち、アクティブマトリクス駆動型液晶表示装置においては、一方の透光性基板上に、液晶に電圧を印加する画素電極が複数形成され、各画素電極を選択駆動するスイッチング素子として薄膜トランジスタやダイオードなどの能動素子が形成されている。一般に、この薄膜トランジスタの半導体層としてはアモルファスシリコンが用いられているが、これは光照射に対する特性依存性および特性劣化が大きいので、通常、アルミニウムやチタンなどの金属材料や黒色顔料をレジスト中に混入させた樹脂材料により光シールドやブラックマトリクス（以下BMといい、樹脂性材料からなるものを樹脂BMという）を形成し、薄膜トランジスタに対する遮光を行っている。

【0004】 このような構成の液晶パネルを2枚の偏光板の間に配置すると、液晶パネルの光学的屈折率の変化が光の透過率の変化として現れるので、これを利用して表示を行うことができる。アクティブマトリクス駆動型TN液晶表示装置においては、偏光板の偏光方向を相互に平行に配置して液晶層に電圧を印加しない状態（オフ状態）で黒色表示を行うノーマリブラック方式と、偏光方向を相互に垂直に配置してオフ状態で白色表示を行うノーマリホワイト方式との2種類に大別される。しかし、表示コントラスト、色再現性および表示の視角依存性の観点からはノーマリホワイト方式の方が望ましい。

【0005】 上述したように液晶表示装置は、一対の基板間に挟持された液晶層内の液晶分子の配向を変え、そのことにより生じる光学的屈折率変化を利用した表示装置であるので、液晶層内で液晶分子ができる限り規則正しく初期配列していることが重要である。

【0006】 通常、液晶分子を初期配列させる方法としては、一対の基板の液晶層側表面にポリイミドなどの配向膜を塗布して配向膜を形成し、その配向膜の表面をレーヨンやナイロンなどの布によりラビングするラビング法が用いられている。また、このラビング法を用いずに配向制御を行う方法として、無機膜の斜方蒸着法や、液晶を配向させるための微細溝、および基板間隙を確保するための突起を一体成形したプラスチック基板を使用する方法（特開平4-305621号公報）などが報告されている。

【0007】 上記TN型液晶表示装置においては、液晶分子が屈折率異方性を有し、基板に対して傾斜（プレチルト）して配向しているので、観察者が液晶表示装置を見る角度（視角）によって表示画像のコントラストが変化し、視角依存性が大きくなるという問題がある。特に、表示画面の法線方向から表示コントラストが良好に

3

なる方向（通常は観測者側）に視角を傾けていくと、特定の角度以上で画像の白黒（ネガ・ポジ）が反転するという反転現象が生じる。

【0008】従来、このような視角依存性を改善するため、例えば特開昭64-88520号公報に開示されているように、所定の配向処理領域をレジストでパターンニングした状態で配向処理を行うことにより、画素内に2つ以上のプレチルト角領域を形成して画素分割する方法が行われている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】上記従来のラビング法では、基板上の配向膜を布でこすって液晶分子を配向させるための微細溝を形成するので、塵埃の発生や静電気の発生により能動素子が破壊されるという問題が生じる。また、樹脂BMを形成する場合に、通常は樹脂BM上にも配向膜を形成するが、樹脂BMの厚みにより配向膜を均一な膜厚にすることができない。このため、配向膜に樹脂BMの厚みによる大きな段差が発生し、基板内において均一な強さのラビング処理を行えないので、配向制御が極めて困難になるという問題がある。

【0010】従来のラビング方法によらない配向制御方法において、液晶を配向させるための微細溝、および基板間隙を確保するための突起を一体成形するには、プラスチック基板を使用する必要がある。このため、一般に広く用いられているガラス基板などには適用することができない。

【0011】また、視角依存性を改善するために、レジストパターンを用いて画素分割する方法では、配向処理のためのラビング工程の回数が増加するので、上述のような塵埃の発生や静電気の発生による能動素子の静電破壊が一層増加する。また、レジストによるパターンニング工程など、製造工程が増加するために製造時間および製造コストが増大するという問題が生じる。

【0012】本発明は、上記従来の問題を解決するもので、複雑な配向処理を用いずに液晶分子の配向制御を行って製造工程を簡略化することができ、さらに、視角依存性を改善することができる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置は、一対の基板間に挟まれた液晶層に信号電圧を印加して画像表示する液晶表示装置において、該基板の液晶層側表面に、側面の表面が少なくとも液晶配向樹脂からなり、該液晶層の液晶分子が該側面に対して略平行または垂直に配向する複数の提状ラインパターンをそれぞれ間隔をおいて設けたものであり、そのことにより上記目的が達成される。

【0014】また、好ましくは、本発明の液晶表示装置における複数の提状ラインパターンの側面がテーパ角を有し、前記一対の基板間に挟まれた液晶層の液晶分子が

4

該側面に対して略垂直に配向され、該提状ラインパターンで仕切られた領域が、該液晶分子の配向状態が異なる複数の領域に分割されている構成とする。

【0015】さらに、好ましくは、本発明の液晶表示装置において、一対の基板の両方に前記提状ラインパターンが形成され、一方の基板上の提状ラインパターンと他方の基板上の提状ラインパターンとが液晶分子のねじれ角となる角度で交差している構成とする。

【0016】さらに、好ましくは、本発明の液晶表示装置における提状ラインパターンの厚みが0.5 μm 以上であり、かつ、一対の基板の間隔の1/2未満である。

【0017】さらに、好ましくは、液晶層を間に挟んで対向配設される前記一対の基板のうち、一方の基板の液晶層側表面に第1電極が形成され、他方の基板の液晶層側表面に第2電極が形成された液晶表示装置において、該第1の電極および第2の電極のうち少なくとも一方の電極上に配向膜が設けられている構成とする。

【0018】さらに、好ましくは、本発明の液晶表示装置における提状ラインパターンが遮光性を有するものであってもよい。

【0019】さらに、好ましくは、本発明の液晶表示装置における提状ラインパターンは、アクリル、ポリイミド、ノボラック、ポリビニルアルコール、ポリケイ皮酸エステル系およびポリアクリル酸エステル系のうち、少なくとも1種の樹脂を含む材料からなるものを用いる。

【0020】

【作用】本発明においては、液晶層を間に挟んで対向配設される一対の基板のうち、少なくとも一方の基板の液晶層側表面に、樹脂からなり、または表面に樹脂層を有する複数の提状ラインパターンが所定の間隔で配置されている。この提状ラインパターンにより液晶分子の配向が基板面に対して側面方向から規制されて、従来のラビング法により得られる微細溝と同様の効果が得られる。一般に、液晶分子は樹脂の表面に対して平行に配向するので、図1に示すように、液晶分子1が提状ラインパターン2の側面に沿って規則正しく平行に配向することになる。この提状ラインパターン2に垂直配向剤を添加または塗布して、図2(a)に示す提状ラインパターン2aとすると、提状ラインパターン2aに液晶分子1を垂直に配向させる配向規制力が生じて、図2(a)に示すように、液晶分子1が提状ラインパターン2aの側面に沿って規則正しく垂直に配向することになる。

【0021】さらに、この提状ラインパターン2aに、図2(b)に示すように、テーパ角を付けて提状ラインパターン2bとすると、液晶分子1がテーパ角を有する提状ラインパターン2bの側面に沿って規則正しく垂直に配向する。よって、基板3に対してプレチルト角が発生し、提状ラインパターン2bで仕切られた領域Eが、液晶分子1の配向状態が異なる2つの領域に分割されることになる。

5

【0022】図3に示すように、一対の基板の両方に提状ラインパターン11、12を形成すると、液晶分子は各々の提状ラインパターン11、12の表面に生じる配向規制力により統制された配向方向を持つことになる。一方の基板上の提状ラインパターン11と他方の基板上の提状ラインパターン12とが液晶分子のねじれ角となる角度で交差するように配置すると、対向する基板の間に挟持される液晶層は、段階的に提状ラインパターン11、12の交差する角度にねじれることになる。この液晶層により光を旋光させることができ、通常のTN型液晶表示装置と同様の原理で表示を得ることができる。

【0023】この提状ラインパターン11、12にテーパー角を付けておくと、図2(b)に示すように基板3に対してプレチルト角が発生する。よって、図3に示すように、提状ラインパターン11、12で仕切られた領域Eは、提状ラインパターン11、12の影響によるチルト角方向1a、1bに液晶分子が配向して、液晶分子の配向状態が異なる4つの領域に分割されることになる。このため、4方向で視角を等しくすることができ、視角依存性を改善することができる。

【0024】さらに、提状ラインパターンの厚みは0.5 μ m以上、かつ、一対の基板の間隔(セルギャップ)の1/2未満であるのが望ましい。厚みが0.5 μ m未満であると、提状ラインパターンの形状による配向規制力が弱くなるおそれがある。通常、TN型液晶表示装置ではセルギャップは5.0~8.0 μ m程度が最適である。

【0025】さらに、一対の基板に形成される第1の電極および第2の電極のうち、少なくとも一方の電極上に配向膜を形成すると、より安定した配向状態を得ることができる。配向膜は、両方の電極上に形成してもよい。両方の電極上に形成した方が、一方の電極上に形成するよりもより安定した配向状態を得ることができる。

【0026】さらに、提状ラインパターンとして遮光性を有するものを形成すると、これを樹脂BMとして、能動素子が提状ラインパターン内にある場合、能動素子の光による特性劣化を防ぐことができ、このために製造工程を増やす必要が無い。

【0027】さらに、提状ラインパターンは、アクリル、ポリイミド、ノボラック、ポリビニルアルコール、ポリケイ皮酸エステル系およびポリアクリル酸エステル系のうち、少なくとも1種類の樹脂を含む材料から形成することができ、また、表面にこのような樹脂層を設けたものであってもよい。このような材料を用いた提状ラインパターンは、水平配向力を有するため、液晶分子を提状ラインパターンの側面に対して平行に配向させることができる。また、このような材料中に垂直配向剤を添加し、または提状ラインパターンに垂直配向剤を塗布すると、垂直配向力を有する提状ラインパターンを形成することができ、液晶分子を提状ラインパターンの側面に

6

対して垂直に配向させることができる。

【0028】

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。

【0029】(実施例1)図4は、本発明の一実施例の液晶表示装置における液晶パネルの1絵素分を示す断面図である。図4において、液晶パネル21は、液晶層22を間に挟んで一対の基板23、24が対向して配設されている。上部の基板23には、その液晶層22側表面に透明電極25が形成され、その上に、上側の液晶分子27を囲むように提状ラインパターン26が形成されている。下部の基板24には、その液晶層22側表面に透明電極(画素電極)28および能動素子としての薄膜トランジスタ29が形成され、その上に、下側の液晶分子27を囲むように提状ラインパターン30が形成されている。この液晶分子27は、提状ラインパターン26、30の側面に対して水平に配向している。以上により液晶表示装置の液晶パネル21が構成される。

【0030】この液晶表示装置の製造は、以下のようにして行うことができる。

20 【0031】まず、バリウム・ホウケイ酸、ナトリウムガラス、プラスチックまたは石英ガラスなどからなる基板21上に電極25を形成し、同様の材料からなる基板4上には、図5に示すようにソースラインS1、ゲートラインG1、薄膜トランジスタ29および透明電極28を形成する。本実施例では、蒸着法によりITOなどからなる電極25、28を膜厚1000オングストロームに形成する。

【0032】次に、基板23、24上に提状ラインパターン26、30を形成する。この提状ラインパターン26、30は、樹脂からなり、または樹脂層を表面に有するものであり、液晶分子に対して配向規制力を有するものであればいずれも用いることができる。本実施例では樹脂BMとして形成し、提状ラインパターン30はソースラインS1の方向に、提状ラインパターン26はゲートラインG1の方向に形成する。このとき、樹脂BMパターンである提状ラインパターン26、30は、隣接する画素電極である透明電極28同士の間が存在し、かつ、絵素部のみを開口してパネル全面を覆うように形成されている。

40 【0033】この樹脂BMの材料としては、例えばアクリル、ポリイミド、ノボラック、ポリビニルアルコール、ケイ皮酸エステル系およびアクリル酸エステル系のうち、少なくとも1種の樹脂を含む材料を用いることができる。このような材料を用いた樹脂BMは、水平配向力を有したものとなる。さらに、感光性材料であればパターンングを精度よく行うことができる。ここでは、黒色顔料が含まれたネガ型レジスト(カラーモザイクCK-2000、富士ハントエレクトロニクステクノロジー社製)を用いて、以下のようにして樹脂BMを形成することができる。

7

【0034】まず、基板23および24上にスピンコート法により上記ネガ型レジストであるカラーモザイクCK-2000を膜厚が2.0 μ mになるように全面塗布し、オープンで90℃、10minの仮焼成を行った後、パターンニングを行った。これにオープンで200℃、60minの焼成を行って、絵素以外の部分に幅25 μ m、間隔が100 μ mの提状ラインパターン26、30を形成する。

【0035】このようにして形成された2枚の基板部を電極形成側を対向させ、セルギャップが6 μ mとなるように貼り合わせる。また、図3に示すように、基板上面から見たときに、樹脂BMパターンの提状ラインパターン26、30が直交して交わり、100 μ m角の絵素部のみが開口されるようにした。貼り合わせた基板部の間隙に液晶を真空注入して液晶層22を設けた。この液晶層22の液晶分子27には種類が極めて多く、選択の範囲も広いが、本実施例では、ZLI-4792（メルク社製）を用いた。また、必要であれば、液晶中にコレステリルノナノエートなどのカイラルドーパントを添加してもよい。この場合、液晶分子27のねじれ方向をより均一に揃えることができる。

【0036】この液晶表示装置においては、液晶層22に含まれる液晶分子27が提状ラインパターン26、30の側面に対して水平に配向するので、液晶分子27の配向制御が可能となり、ラビングなどの複雑な配向処理を行わないでもTN型液晶表示機能を実現することができる。さらに、凸状パターンである提状ラインパターン26、30が樹脂BMからなるので、薄膜トランジスタ29の光による劣化や特性変化が生ずることなく、安定した表示特性を得ることができる。

【0037】（実施例2）本実施例では、基板部の電極25、28上にそれぞれ、図6に示すような水平配向膜31、32を形成し、それ以外は実施例1と同様に構成して液晶表示装置を作製した。これら水平配向膜31、32としてはオプトマーAL4552（日本合成ゴム社製）を用い、膜厚が700オングストロームになるように印刷法により塗布する。

【0038】本実施例の液晶表示装置においては、実施例1の液晶表示装置よりもさらに安定した配向状態を得ることができた。また、この水平配向膜31、32は、ラビングなどの配向処理を必要とせず、従来のものに比べて製造工程を削減することができる。

【0039】（実施例3）本実施例では、図7に示すように基板23、24上にそれぞれ電極25、28がそれぞれ設けられ、電極25、28上にそれぞれ設けられた提状ラインパターン26a、30aとして、テーパー角を有する樹脂BMパターンを形成し、その表面に垂直配向剤を塗布したものである。それ以外は実施例1と同様に構成して液晶表示装置を作製した。

【0040】この樹脂BMパターンの材料としては実施

8

例1と同様に、黒色顔料が含まれたネガ型レジスト（カラーモザイクCK-2000、富士ハントエレクトロニクステクノロジー社製）を用い、垂直配向剤としてはN-Nジメチル-n-テトラデシルアミンを用いて、以下のようにして樹脂BMを形成した。この樹脂BMの提状ラインパターン30aはソースラインS1の方向に、提状ラインパターン26aはゲートラインG1の方向に形成する。このとき、これら樹脂BMパターン26a、30aは、隣接する画素電極28同士の間が存在し、かつ、絵素部のみを開口してパネル全面を覆うように形成する。

【0041】まず、実施例1と同様にして電極25、28および薄膜トランジスタ29を形成した基板23、24上にスピンコート法によりネガ型レジストであるカラーモザイクCK-2000を膜厚が2.0 μ mになるように全面塗布し、オープンで90℃、10minの仮焼成を行った後、パターンニングを行った。このパターンニングは、提状ラインパターン30aをソースラインS1の方向に、提状ラインパターン26aをゲートラインG1の方向にして、これら提状ラインパターン26a、30aの樹脂BMパターンが、隣接する画素電極28同士の間が存在し、かつ、絵素部のみを開口してパネル全面を覆うように行う。次に、この樹脂BM表面に、N-Nジメチル-n-テトラデシルアミンを付着させた後、オープンで200℃、60minの焼成を行って、絵素以外の部分に幅25 μ m、その間隔が100 μ mであり、基板上面から見たときに若干のテーパー角を有する提状ラインパターン26a、30aを形成する。

【0042】この液晶表示装置においては、液晶層22に含まれる液晶分子27が提状ラインパターン26a、30aの側面に対して垂直に配向するので配向制御が可能となり、ラビングなどの複雑な配向処理を行わないでもTN型液晶表示機能を実現することができる。また、提状ラインパターン26a、30aがテーパー角を有するのでチルト角が形成され、1画素内において液晶分子27がそれぞれの近傍の提状ラインパターン26a、30aの配向規制力とチルト角との影響により4種類の配向状態を示している。よって、図3に示すように1画素内が4分割されて、上下左右方向の視角依存性を大幅に改善することができる。さらに、提状ラインパターン26a、30aの凸状パターンが樹脂BMからなるので、薄膜トランジスタ9の光による劣化や特性変化が生じることなく、安定した表示特性が得られる。

【0043】なお、本実施例では、提状ラインパターン26a、30aに垂直配向材を塗布したが、提状ラインパターン26a、30aの材料中に垂直配向材を添加してもよい。

【0044】（実施例4）本実施例では、電極25、28上に、図8に示すような水平配向膜31、32を形成し、それ以外は実施例3と同様にして液晶表示装置を作

製した。これら水平配向膜31、32としてはオプトマーAL4552（日本合成ゴム社製）を用い、膜厚が700オングストロームになるように印刷法により塗布する。

【0045】本実施例の液晶表示装置においては、実施例3の液晶表示装置よりもさらに安定した配向状態を得ることができる。また、この水平配向膜31、32は、ラビングなどの配向処理を必要とせず、従来のものに比べて製造工程を削減することができる。

【0046】なお、本発明の液晶表示装置は、上記各実施例に示したものに限らず、種々の材料を用いて作製することができる。また、ここでは、能動素子として3端子非線形素子である薄膜トランジスタを用いたが、2端子非線形素子であるMIM素子などを用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置にも適用可能である。さらに、液晶セルの外側に1枚の反射板を配置するか、または片側の電極を反射板とすることにより、反射型表示装置にも適用することができる。さらに、カラーフィルターなどと組み合わせることにより、カラー表示装置として用いることも可能である。

【0047】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、基板の液晶層側表面に設けられた提状ラインパターンにより、基板面に対して側面方向から液晶分子の配向が規制されるため、従来のラビング法のように、製造工程中に塵埃の発生や静電気の発生により能動素子が破壊されるという問題は生じない。また、樹脂BMを形成して配向膜に大きな段差が発生しても、ラビング処理を行う必要が無いので、安定した配向制御を行うことができる。さらに、複雑な配向処理を必要としないので、製造工程を大幅に簡略化することができる。さらに、一般に広く用いられているガラス基板に適用することができ、安価に製造することができる。

【0048】また、垂直配向材を添加し、または表面に塗布して形成した提状ラインパターンにテーパ角を持たせることにより、上記効果に加えて、容易にプレチルト角を発生させることができる。よって、従来のような複雑な配向処理を行わなくても、画素内を分割して配向状態が異なる複数の領域を形成することができ、上下左右

方向の視角依存性を大幅に改善して高画質の液晶表示装置を実現することができる。

【0049】さらに、提状ラインパターンに遮光性を持たせることにより、薄膜トランジスタなどの能動素子の光による劣化や特性変化を防いで安定した表示特性を維持することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である液晶表示装置の液晶分子の配向状態を示す平面図である。

10 【図2】(a)は本発明の他の実施例である液晶表示装置の液晶分子の配向状態を示す平面図であり、(b)は本発明のさらに他の実施例である液晶表示装置の液晶分子の配向状態を示す断面図である。

【図3】本発明の他の実施例である液晶表示装置を上から見た場合の液晶分子の配向状態を示す平面図である。

【図4】本発明の一実施例である液晶表示装置における液晶パネルの1絵素分を示す断面図である。

【図5】本発明の一実施例である液晶表示装置のアクティブマトリクス基板の構成を示す図である。

20 【図6】本発明の別の実施例である液晶表示装置における液晶パネルの1絵素分を示す断面図である。

【図7】本発明のさらに他の実施例である液晶表示装置における液晶パネルの1絵素分を示す断面図である。

【図8】本発明のさらに他の別の実施例である液晶表示装置における液晶パネルの1絵素分を示す断面図である。

【符号の説明】

1、27 液晶分子

1a、1b 提状ラインパターンの影響によるチルト角方向

2、2a、2b、11、12、26、26a、30、30a 提状ラインパターン

21 液晶パネル

22 液晶層

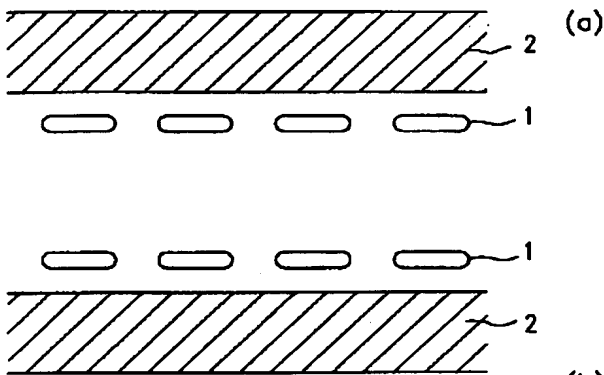
23、24 基板

25、28 透明電極

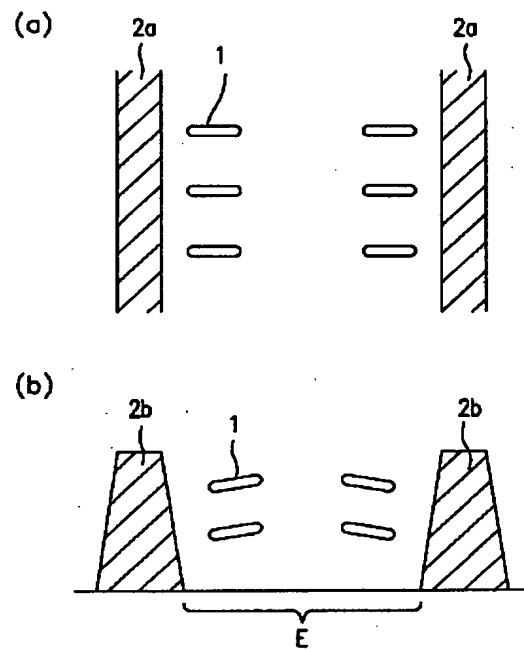
29 薄膜トランジスタ

31、32 水平配向膜

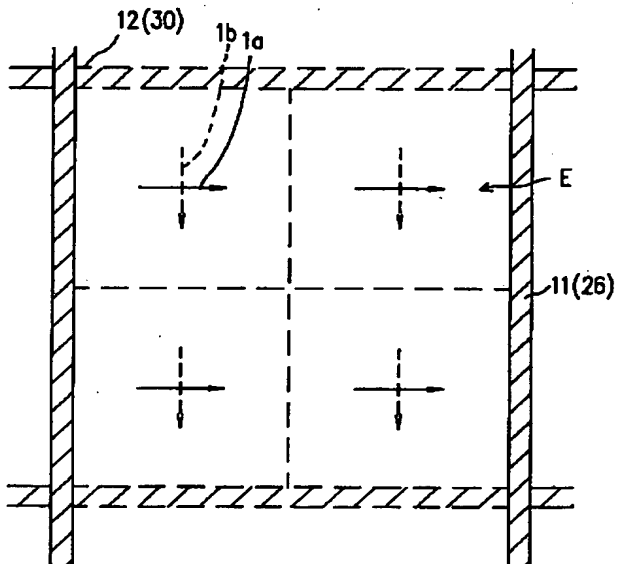
【図1】



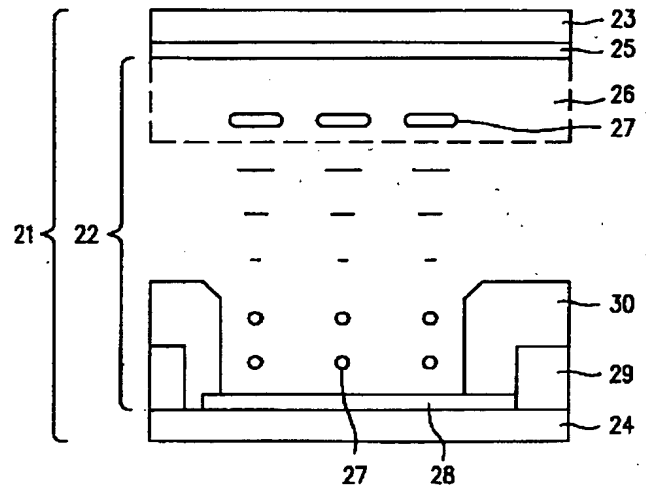
【図2】



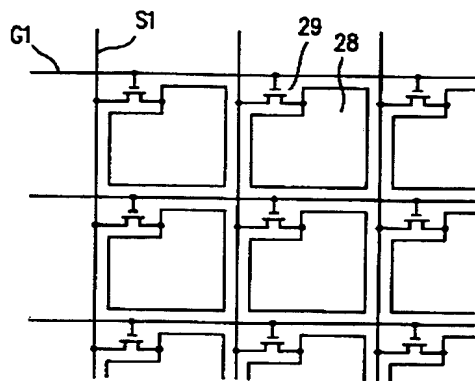
【図3】



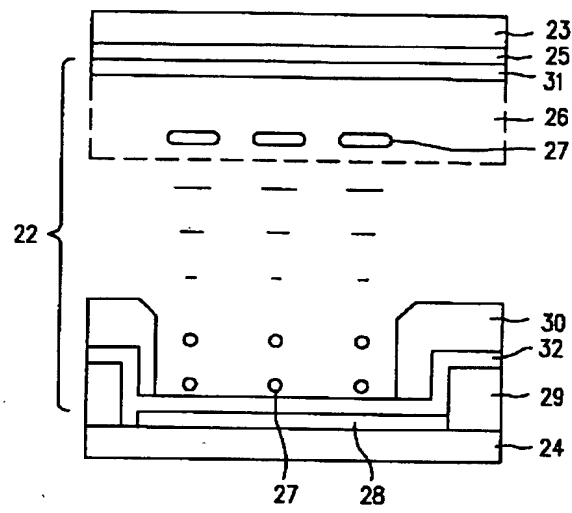
【図4】



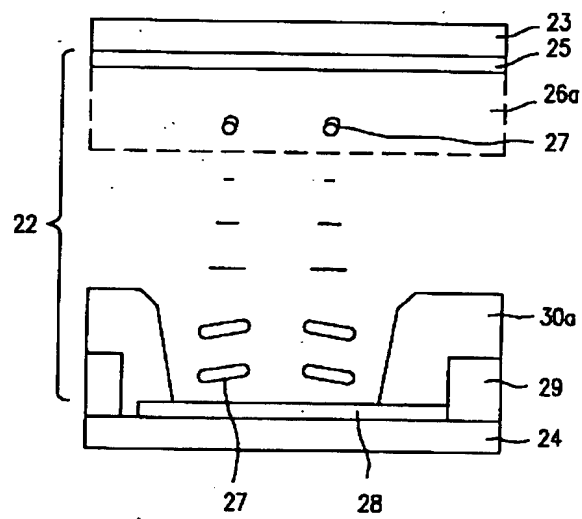
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

